入門講座

# Java による実践的科学技術プログラミング(Ⅱ) —拡散相分離の Phase-field シミュレーション—

# 小山敏幸\*

#### 2.1 はじめに

今回は、先回のプログラムを修正して、拡散相分離の Phase-field シミュレーションプログラムを2種類作成する. 1つは1次元濃度プロファイルの時間発展を計算するプログ ラムで、もう1つは2次元濃度場の時間発展プログラムで ある.いずれも合金系は相分離型の仮想的なA-B2元系を 想定し、不規則相における2相分離の計算を行う.読者は 是非とも、ご自身のパソコンで計算を試みられたい.そして 拡散現象が目の前にてリアルタイムで進行していく様子を楽 しんでいただきたい.以下、まず計算手法について説明し、 その後、ソースコードとともにプログラムの解説を行う.

# 2.2 計算手法

#### 2.2.1 A-B2元系における α相の相分離の計算式

相分離する相をα相とする.本計算は,不規則 A-B 2 元 系におけるα相の相分離が対象であるので,秩序変数は濃 度場のみであり,したがって,本計算の Phase-field法<sup>(1)-(4)</sup> は,従来の Cahn-Hilliard の非線形拡散方程式に基づく相分 離の計算手法に等しい<sup>(5)(6)</sup>.ここでは独立な秩序変数として B成分のモル分率を採用する.Phase-field法では,まずこ の独立な秩序変数を用いて全自由エネルギーを汎関数形式に 定式化し,この全自由エネルギーが最も効率よく減少するよ うに,その秩序変数の発展方程式(この場合は2元系の非線 形拡散方程式)が定義される.この発展方程式を数値計算す ることによって,秩序変数の時間および空間発展(すなわち 組織形成過程)が算出される<sup>(1)</sup>.以下まず,使用する全自由 エネルギーの計算式について説明する.

# (1) 全自由エネルギーの計算式

A-B2元系のα相の原子1モル当たりの化学的自由エネ ルギーは,正則溶体近似に基づき,

 $G_{c}^{\alpha}(c, T) = {}^{\circ}G_{A}^{\alpha}(T)(1-c) + {}^{\circ}G_{B}^{\alpha}(T)c + L_{A,B}^{\alpha}c(1-c)$ 

$$+RT\{c\ln c + (1-c)\ln (1-c)\}$$
(1)

にて与えられる<sup>(7)</sup>. c が B 成分のモル分率である. 組織形成 過程の計算であるので、cは時間tおよび組織内の位置 $\mathbf{r}$ = (x, y, z)の関数として $c(\mathbf{r}, t)$ と表記するのが正しいが,ここ では式の煩雑さを避けるためにcと記す.  $G_x(T)$ は純成分 X(=A,B)の自由エネルギーで,温度Tの関数である.R はガス定数で、右辺最後の項が原子の配置のエントロピーに 起因するエネルギー項である.右辺第3項が混合の過剰エ ンタルピー項で、係数のLABは相互作用パラメータと呼ば れる. La, Bは一般的には温度および組成の関数であるが, 本計算では定数と仮定し $L_{A,B}^{\alpha}=25[kJ/mol]$ とおいた.本計 算は同一結晶構造内での等温時効における拡散相分解を対象 とするので,自由エネルギーの基準の0として改めて,  $^{\circ}G_{A}^{\alpha}(T)(1-c) + ^{\circ}G_{B}^{\alpha}(T)c$ を採用しても計算結果は影響を受 けない.(拡散相分離の計算では,拡散ポテンシャルの空間 勾配が溶質移動の駆動力になる.拡散ポテンシャルを計算す る際に自由エネルギーの組成に関する1次項は定数となり (温度一定), さらに拡散ポテンシャルの空間勾配を計算する 際に、この定数は消えてしまう).したがって、ここでは、 議論を簡単にするために, 自由エネルギーの基準について,  $G_A^{\alpha}(T) = G_B^{\alpha}(T) = 0$ と設定する.

次に界面エネルギーについて説明する.実際の界面エネル ギーには、界面位置における平均場の化学的自由エネルギー も含まれるので、界面エネルギーと濃度勾配エネルギーは正 確には異なるが、ここでは(界面エネルギー)=(濃度勾配エ ネルギー)として話を進める.計算式は、

$$E_{\rm surf} = \frac{1}{2} \kappa_c (\nabla c_A)^2 + \frac{1}{2} \kappa_c (\nabla c_B)^2$$

<sup>\* (</sup>動物質・材料研究機構新構造材料センター,組織・特性計算グループ 主幹研究員(〒305-0047 つくば市千現 1-2-1) Practical Java Programming in Materials Science and Engineering (Ⅱ) —Phase-field Simulation of Diffusional Phase Decomposition—; Toshiyuki Koyama (National Institute for Materials Science, Structural Metals Center, Tsukuba) Keywords: *Jave application, Windows software, phase decomposition, spinodal decomposition, Phase-field method, diffusion equation* 2009年5月11日受理

$$= \frac{1}{2} \kappa_c \{ \nabla (1-c) \}^2 + \frac{1}{2} \kappa_c (\nabla c)^2$$
$$= \kappa_c (\nabla c)^2 \qquad (2)$$

にて与えられる<sup>(1)(6)</sup>.スピノーダル分解の計算では濃度勾配 エネルギー係数 $\kappa_c$ は通常,方向に依存しない定数と仮定さ れる. $\kappa_c$ の値は,原子間相互作用パラメータ $\Omega$ ,界面エネル ギー密度 $\gamma_s$ ,界面幅 $d_1$ ,および相互作用距離<sup>(8)</sup> $d_2$ を用い て,近似的に見積もることが可能である<sup>(9)</sup>.本計算では, $\kappa_c$ = 5.0×10<sup>-15</sup>[J·m<sup>2</sup>/mol]と置いた. $\kappa_c$ の単位については, ここでは化学的自由エネルギーの単位[J/mol]との整合性か ら[J·m<sup>2</sup>/mol]を採用しているが,モル体積で割って[J/m] としている場合が多い点を記しておく.なお本講座はプログ ラミングに重点を置いているので,議論を簡単にするために 弾性歪エネルギーは考慮しない.

以上から,全自由エネルギーは,化学的自由エネルギーと 界面エネルギー(濃度勾配エネルギー)の和として,空間積分 における汎関数形式にて,

$$G_{\text{sys}} = \int_{\mathbf{r}} \left[ L_{A,B}^{\alpha} c(1-c) + RT \{ c \ln c + (1-c) \ln (1-c) \} + \kappa_{c} (\nabla c)^{2} \right] d\mathbf{r}$$
(3)

と表現される.  $G_{sys}$ のcによる変分は、変分原理に基づき、

$$\frac{\delta G_{\rm sys}}{\delta c} = \frac{\partial G_c^{\alpha}}{\partial c} - 2\kappa_c \nabla^2 c \qquad (4)$$

にて与えられ<sup>(1)(6)</sup>,これは拡散ポテンシャルと呼ばれる.

#### (2) 発展方程式(非線形拡散方程式)の計算式

計算に用いる非線形拡散方程式(1)は,

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \nabla \cdot \left( M_c(c, T) \nabla \frac{\delta G_{\text{sys}}}{\delta c} \right)$$
(5)

にて与えられる. $M_c(c, T)$ は原子の拡散の易動度で,組成 および温度の関数であるが<sup>(1)</sup>,合金組成 $c_0$ および温度Tの 関数 $M_c(c_0, T)$ と近似する.式(4)を代入すると,

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \nabla \cdot \left[ M_c(c_0, T) \nabla \left\{ \frac{\partial G_c^{\alpha}}{\partial c} - 2\kappa_c \nabla^2 c \right\} \right]$$
$$= \nabla \cdot \left[ M_c(c_0, T) \left( \frac{\partial G_c^{\alpha}}{\partial c^2} \right) \nabla c \right] - 2M_c(c_0, T) \kappa_c \nabla^4 c$$
(6)

を得る.ここで、 $\tilde{D} \equiv M_c(c_0, T) (\partial^2 G_c^{\alpha} / \partial c^2)$ および $\tilde{K} \equiv M_c(c_0, T) \kappa_c$ と置くと、Cahn-Hilliard の非線形拡散方程式

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \nabla \cdot (\tilde{D} \nabla c) - 2\tilde{K} \nabla^4 c \qquad (7)$$

に一致することがわかる.  $\hat{D}$ は相互拡散係数に他ならない.なお実際の相分離シミュレーションでは,式(4)の拡散ポテンシャル $\mu_{sys} \equiv \delta G_{sys} / \delta c$ を位置の関数 $\mu_{sys}(\mathbf{r}, t)$ として数値計算し,式(5)を

$$\frac{\partial c}{\partial t} = M_c \nabla^2 \mu_{\rm sys} \tag{8}$$

と変形して、差分法を用いて数値計算した方が効率的である. つまり組織内の任意の点における拡散ポテンシャル  $\mu_{sys}(\mathbf{r}, t)$ を式(4)から求め、 $\mu_{sys}(\mathbf{r}, t)$ について直接、差分 計算を行う手法である.

最後に2次元計算を例に,拡散方程式の無次元化につい

ま て り あ 第48巻 第10号(2009) Materia Japan て説明する<sup>(9)</sup>.まずエネルギーは *RT* にて無次元化する.ま た 2 次元計算領域の 1 辺の長さを *L*,差分計算の分割数を *N* とすると,差分による空間分割セルの一辺の長さ  $b_1$  は,  $b_1 = L/N$  である.この  $b_1$ を用いて距離を無次元する(差分計 算を容易にするため).また時間は  $b_1^2/D$  にて無次元化され る(*D* は拡散係数).本計算では等温時効を想定しているの で,易動度  $M_c(c_0, T)$  は定数  $M_c$  となる.また拡散係数と易 動度の関係式(後述)より, $M_c$ の次元は[m<sup>2</sup>/s]/[J/mol]であ る.以上より 2 次元(*x*, *y*) における非線形拡散方程式を,次 元と合わせて表現すると,

$$\frac{\partial c}{\partial t} = M_c \left( \frac{\partial^2 \mu_{\text{sys}}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \mu_{\text{sys}}}{\partial y^2} \right) : \left[ \frac{1}{s} \right] = \left[ \frac{\text{m}^2/\text{s}}{\text{J/mol}} \right] \left[ \frac{\text{J/mol}}{\text{m}^2} \right] \quad (9)$$

となり, 無次元化した方程式は,

$$\frac{\partial c}{\partial \left(\frac{t}{b_1^2/D}\right)} = \frac{M_c RT}{D} \left(\frac{\partial^2 \left(\mu_{\text{sys}}/RT\right)}{\partial \left(x/b_1\right)^2} + \frac{\partial^2 \left(\mu_{\text{sys}}/RT\right)}{\partial \left(y/b_1\right)^2}\right)$$
(10)

となる.ここで濃度勾配エネルギー定数  $\kappa_c$  は  $b_1^2 RT$  にて無 次元化される.

自己拡散係数  $D_X^*(X = A, B) \ge M_c(c, T)$ には

$$M_{c}(c, T) = \left(\frac{D_{B}^{*}}{RT}(1-c) + \frac{D_{A}^{*}}{RT}c\right)c(1-c)$$
(11)

の関係がある<sup>(1)(6)</sup>.  $D_x^*$ は固溶体中における X 原子の自己拡 散係数であるので,正確には  $D_x^*$ は温度および濃度(媒質の 固溶体の濃度)の関数であるが,ここでは最も単純に, $D_A^* = D_B^* = D$  と置き,かつ組成 c については合金組成  $c_0$  にて近似 する.したがって,式(11)を変形することにより,式(10) 右辺の係数部分が, $M_c RT/D = c_0(1-c_0)$ と導かれる.実際に 相分解シミュレーションを行う際に,拡散係数の値は,無次 元化された計算時間  $t' = t/(b_1^2/D)$ を実時間 t に変換する時に のみ必要になる.無次元化された非線形拡散方程式は最終的 に

$$\frac{\partial c}{\partial t'} = c_0 (1 - c_0) \left( \frac{\partial^2 (\mu_{\text{sys}}/RT)}{\partial (x/b_1)^2} + \frac{\partial^2 (\mu_{\text{sys}}/RT)}{\partial (y/b_1)^2} \right)$$
(13)

であるので,無次元化された計算時間 t' にて議論する限り においては,拡散係数の値自体は特に必要ではない.なお本



計算では核形成-成長過程も計算するので,実際の計算では 濃度揺らぎ項も乱数を用いて導入している.

#### (3) A-B 2 元系状態図

計算に用いた A-B2 元系の状態図を図1に示す.ここで は α 相のみを考慮している(液相は考慮していない).実線 がバイノーダル線,および点線がスピノーダル線である.相 分離の計算は,高温の単相領域で溶体化した状態を初期状態 とし,それを2 相領域に持ちきたして等温時効した時の相 分離過程を対象とする.時効温度は1000 K とする.この温 度における平衡組成とスピノーダル組成はそれぞれ, *c*<sub>Bi</sub> = 0.07 および  $c_{\rm sp}$ =0.21,  $c_{\rm Bi}$ =0.93 および  $c_{\rm sp}$ =0.79 である. さて、プログラムの説明に入ろう.

# 2.3 プログラムの説明と計算例

基本的なプログラムの構造は,先回説明した F\_curve に 等しい.まず1次元濃度プロファイルの時間発展のプログ ラムを以下に示す.プログラム名は,PD1D\_001.java であ る.プログラムの実行方法等は,先回の説明を参照していた だきたい.さて先回同様,説明をプログラム内に記す.

$\downarrow$					
//***「プロ	コグラム(PD1D 001.java)] *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	$Mc = c0^*(1.0 - c0);$	//拡散の易動度	
//***「インボート文」 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			c_flu=0.1;	//濃度ゆらぎ振幅の最大値	
import java.awt.*;					
import jav	va.awt.event.*;		// 時間 0 における初期濃度プロフ	'ァイル設定	
import jav	/a.io.";		prog.ini_comp_field();	//乱奴によって生成する場合	τ̈́
public cla	ass PD1D 001 extends Frame{		//prog.datin();	// ノアイルから記み込む場合	ī
			// 濃度プロファイルの時間発展の	)計算	
//*** [グロ	コーバル変数] * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	while(timel $< = timelmax)$ {		
stat	ic int ND = 512;	//組織1辺の分割数			
stat	ic int nd = ND;	//濃度の分割数	// 濃度プロファイルの表示		
stat	ic int ndm=ND-1;	//濃度の分割数-1 //window なけの幅	if((((int)(timel)%500)	==0)){prog.repaint();}	
stat	ic int height:	//Window 全体の高さ	//	イガリント数が5000倍数ねさ	に <i>辰</i> 度ノロノアイル/抽画
stat	ic int xwidth;	//描画領域の幅	if((((int)(time1)%1000)	$= = 0) \{ prog.datsave(); \}$	
stat	ic int yheight;	//描画領域の高さ	/	//カウント数が1000の倍数おき	きに濃度プロファイル保存
stat	ic int insetx;	//Window の枠の幅(左右および下)	$//if(timel = = 3000.0)$ {pr	og.datsave();}	
stat	ic int insety;	//Window の枠の幅(上)	/	//カウント数が3000の時に濃度	<b></b> 受プロファイル保存
stat	ic double PI = 3.141592;	//π //ガマ <i>中</i> 称	// 拡動ポテンジャルの計算		
stat	ic double []ch = new double[NI	// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	for $(i = 0; i < = ndm; i + +)$	{	
stat	ic Graphics g;	//自由エネルギー曲線画面のグラフィックスオブジェクト	ip = i + 1; im = i - 1;	(	
stat	ic double time1;	//計算時間(カウント数)	$if(i = ndm) \{ip = 0;\}$ if(	$i = = 0) \{im = ndm;\}$	//周期的境界条件
stat	ic double temp;	//温度(K)	c2 = ch[i]; c1 = 1.0 - c2;		//位置 i における cl と c2
stat	ic double c0;	//合金組成(モル分率)	c2ip=ch[ip]; c2im=ch[i	.m];	//差分においてc2の左右の濃度
//*** [>	····· ·· ··· ·· ··· · · · · · · · · ·	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			//小学学三、小、小学
publ			$mu\_cnem = L0^{\circ}(c1 - c2) + Ma$ $mu\_surf = -2^{\circ}0^*kappa\_c^*(c1 - c2)$	$(c^{2}in + c^{2}im - 2 \cdot 0^{*}c^{2})$ ;	//1L子小ナノンヤル左 //濃度勾配のポテンシャル
xw	idth = 800; yheight = 200;	//描画画面の構と縦の長さ(ピクセル単位)	ck[i] = mu chem + mu surf;	(chip) (chim 100 ch))	// 捩皮ス記のホテンシャル
in	setx = 4; insety = 30;	//描画画面の枠の長さ	}		// MARKAGE DE COM
wi	dth = xwidth + insetx*2;	//描画 Window 全体の横の長さ			
he	ight = yheight + insetx + inset	sty; //描画 Window 全体の縦の長さ	// 濃度場の時間変化(非線形拡散)	方程式の差分解陽解法)	
se	tSize(width, height);	//描画 Window のセット	for $(i = 0; i < = ndm; i + +)$	{	
se	tBackground(Color.white);	// 抽画 Window の抽画部の色を日に設定	ip=i+1; im=i-1; if(i)	$= = ndm) \{ip = 0;\} if(i = = 0)$	{im=ndm;} // 周期的境界条件 //世始取起版大和卡
se	dwindowListener(new WindowA	// 捆囲 Window を見えるよりにする danter() /	$cddtt = Mc^{-}(ck[1p] + ck[1n])$	ij - 2.0 °CK[1]);	// 非称形仏取力性氏 // 濃度提の時間登展
uu	public void windowClosing(W	indowEvent e){System.exit(0);}	ch2[i] = ch[i] + (cddtt + cddtt)	<pre>c flu*(2.0*Math.random() - ?</pre>	1.0))*delt;
		//Window を閉じる時の操作(Window の右上×の設定)		//濃度:	場の時間発展(濃度揺らぎを考慮)
})	;		}		
}					
//*** [ ]		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	//*** [濃度場の収支の補正] * * * *	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
//*** [× 4	「ンフロクラム」 * * * * * * *	************************************	//***	、 文の 補止を行う (実際には毎) か、 イート) (auma	ステッフ行う必要はない) * * *
publ	ic static void main(String[]	args)throws Exception{//例外処理は行わない	sumc = 0.3 for $(1 = 0)$ $1 < = ncdc = sumc/(double) nd = c0.3$	$\operatorname{Jm}$ ; 1 + + ) { $\operatorname{sumc}$ + = $\operatorname{cn2}[1]$ ;	// 震度ノロノァイルの痕分  / 濃度プロファイルの変動量
PD	1D 001 prog = new PD1D 001();	; //PD1D 001のインスタンス prog を生成			川便反ノーノノールの変動重
			for $(i = 0; i < = ndm; i + +)$	{	
in	ti;	//整数	ch[i] = ch2[i] - dc;		//濃度場の補正
in	t ip, im;	//整数(i+1, i-1)	$if(ch[i] > =1.) \{ch[i] = 1$	1.0-1.0e-6;}	//濃度が1を超えた場合の補正
do	uble delt;	//時間刻み(無次元)	$if(ch[i] < =0.) \{ch[i] = 1$	0e-6;}	//濃度が0を切った場合の補正
do	uble al;	//計算領域の1辺の長さ //計算時期(見上まさい1数)	}		
ob ob	uble[]ck = new double[ND];	// 計昇时间(取入カワント数) // 拡散ポテンジャル	//***「時間摘加]* * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *
do	uble[]ch2 = new double[ND];	//組織内の濃度データ予備配列	// [011028/04]		
do	uble mu chem, mu surf;	//各ポテンシャル	<pre>timel = timel + 1.0;</pre>		//計算時間の増加
do	uble cl, c2;	//濃度(A:1,B:2)	}//while		
do	uble L0;	//原子間相互作用パラメータ			
do	uble kappa_c;	//濃度勾配エネルギー係数	//		
ob do	uble c flut	//	System.out.print: (''¥n 然了! 士!	た ガラフのナト×をクリッ	$D \mid \tau $ 奴 $\tau \mid \tau < \tau < t > 1$ 、 ¥n");
do	uble cddtt;	// 張皮物の描りさり入ささ //濃度の増分	}//main	に、シラフの石工へをシリッ	シレ(松」してくたさい。 *** )
do	uble bl;	//差分ブロックサイズ	//以下はサブルーチン		
do	uble c2ip, c2im;	//差分において c2 を中心に,その左右の濃度	//*** 初期濃度場設定 * * * * * * *	*************	* * * * * * * *
do	uble sumc, dc;	//濃度場の総和,半均組成からのすれ	<pre>public void ini_comp_field()</pre>	{	
//	パラメータ設定		double rnd0, facl:		
te	mp = 1000.0; //[	K			
c0	=0.4; ///	合金の平均組成(ここでは A-40 at%B 合金を設定している)	fac1 = 0.01;	//初期濃度	「揺らぎの最大変化量を1%に設定
de	lt = 0.01;		for $(i = 0; i < = ndm; i + +)$	{	
ti	mel=0.0; //	計算の繰返し回数	rnd0 = 2.0 *Math.random()	-1.0; ch[i] = c0 + rnd0*fac1	<ul> <li>         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>
ti	melmax = 1.0e + 08; //;	果返し回数の敢大値	}		
al	= 500.0; //5	2 次元計算領域の1辺の長さ(nm)	,		
al	=al*1.0e-9; //2	(m)に変換	//*** 濃度場描画 * * * * * * * * *		* * * * * * *
b1	= a1/(double)nd; //3	差分1ブロックのサイズ	public void paint(Graphics g)	1{	
			int i, ii, i1, ii1, i2, ii2;	1	
LO	= 2.5e+04; ///	原子間相互作用パラメータ(J/mol)	double x, xmax, xmin, dx, y	, ymax, ymin, dy, d0;	
LO	=L0/RR/temp; //	無次元化	double c, cmax, cmin;		
k ~	nna c=5.0e=15.	豊安勾配ェネルギー係数 単位/ナ「ァm^?//mへ1]	double gxl, gyl, gx2, gy2;	max. igyl. igyl igyl igyl igy	. id0:
ka ka	ppa c=kappa c/b1/b1/RR/tem	成区つり出上 クル T 一 示奴, 半区(よし m 2/m01」   p; //(b1 2*rr*temp)で無次元化	int idx, idv;	, 19A1, 19Y1, 19A2, 19Y2	, 100/
	,,,,,		double col;		7
					/

xmin = 0.; xmax = 1.; dx = 0.1;	// 横軸の最小値,最大値,分割間隔(実際の値)				
ymin = 0.1; $ymax = 1.1$ ; $dy = 0.1$ ; cmin = 0.0; $cmax = 1.0$ ;	//縦軸の取小値,取入値,刀刮间層(天际の値) //遮庇の最小値 最十値(実際の値)				
ixmin = 0: iymin = 0: ixmax = xwidth:iyma:	cmin=0.0; cmax=1.0; // 仮及の取小胆, 取入胆(天际の胆)				
	//ピクセル単位の場合				
idx = (int)(0.1*ixmax);	// C/ C// +E// W1				
idy = (int) (0.1*iymax);					
g.setColor(Color.white);	//色を白に設定				
g.fillRect(insetx, insety, xwidth, yheight); //画面を上で指定した色で塗る					
g.setColor(Color.black); //色を黒に設定					
g.drawRect(insetx, insety, xwidth, yhei	.ght); //グラフの外周を上で指定した色で描く				
//クラフ内の縦横の線を等同隔に描く					
$tor(1=0; 1 < = 1xmax; 1 + = 1dx) \{g.drawl}$	Line(insetx + 1, insety + 1ymin,				
$f_{on}(i=0, i < -i m_{on}, i + -i d_{i}) \left\{ a = d_{i} \right\}$	finsetx + 1, finsety + fymax);;				
201(1-0) 1< - 1ymax; 1+ - 1dy)(g.draws	incoty + ixmax incoty + i);				
d0 = 1.0/(double) nd/2.0;	//羊分ブロックの長さの半分				
id0 = 1 + (int)(((double)ixmax - (double))	ixmin)/(xmax - xmin)*d0);				
	//aoのピクセル化				
<pre>System.out.printf(``%f %n'', timel);</pre>	//計算の繰返し回数を標準入出力に表示				
g.setColor(Color.red);	//色を赤に設定				
for $(i = 0; i < = ndm; i + +)$ {					
//濃度フロファイルの値(実際の値)					
11 = 1; $12 = 1 + 1$ ; $\pi u^2 = 1$ /(double) $\pi d^*$ (double) $i^2 = d^2 = 0$ ;	$n_2 = 1 / (double) = d^* (double) + 2 + 40$				
$gx1 = 1./(double) na^{(double)} 11 + d0; gx2 = 1./(double) na^{(double)} 12 + d0;$					
qv1 = (ch[ii1] - cmin)/(cmax - cmin); q	$y_2 = (ch[ii2] - cmin) / (cmax - cmin);$				
971 (On[III] Omin)/(Omen Omin)/ 972 (On[II2] Omin)/(Omen Omin)/					
//濃度プロファイルの値をスクリーン座	標に変換				
igxl = (int) (((double)ixmax - (double)ixmin)*(gxl - xmin)/(xmax - xmin))					
+ (double)ixmin);					
igy1 = (int) ((double) iymin + (double) iymax					
-(((double)iymax - (double)iymin)/(ymax - ymin)*(gyl - ymin)					
+ (double)iymin));					
igx2 = (int)(((double)ixmax - (double)ixmin)*(gx2 - xmin)/(xmax - xmin)					
+ (double)ixmin);					
igy2 = (int)((double)iymin+(double)iymax					
= (((double)) iymax = (double))	.ymin)/(ymax-ymin).(335-ymin)				
(double)lymin));					

本計算では、初期濃度プロファイルを乱数にて設定してい るので、最後のサブルーチンは使用していない.図2はプロ グラム実行結果の1例で、A-40 at%B合金の1000K等温 時効における濃度プロファイルの時間発展である.初期に典 型的なスピノーダル分解が生じ、時効の進行に伴い、濃度ピ ーク同士が互いに溶質を奪い合ってオストワルド成長してい く様子が計算されている.

次に合金組成を変えて、同様に相分解させた時の濃度プロファイル(時間 t' = 3000における結果)を図3に示す.状態 図の中央組成付近では、典型的なスピノーダル分解組織となるが、合金組成が低下して、ほぼスピノーダル線上の $c_0 = 0.2$ では、濃度プロファイルの周期性が若干崩れてくる.合金組成がスピノーダル線とバイノーダル線の中央付近である $c_0 = 0.15$ では、まばらに濃度ピークが形成され、核形成-成

outfile.println(timel); //カウントの書き込み for(i=0; i<=ndm; i++){outfile.println(ch[i]);} //濃度場の書き込み outfile.close(); ァイルのクローズ //\*\*\* [データの読込み] \* \* \* \* \* \* \* \* private void datin()throws Exception{ int i; String s data; BufferedReader infile = new BufferedReader (new FileReader (''ini000.dat'')); //ファイルのオープン s data = infile.readLine(); //文字列として読み込み  $timel = new Double(s_data).doubleValue(); for (i = 0; i < = ndm; i + +)$ //文字を数値へ変換 data = infile.readLine(); //文字列をして読み込み ch[i]=new Double(s data).doubleValue(); //文字を数値へ変換 infile.close(); //ファイルのクローズ \* \* \* \* \* }//PD1D\_001 \*\* プログラム終了 長型相分離の特徴を示すようになる. 最後に合金組成がバイ ノーダル線のすぐ内側の c<sub>0</sub>=0.1では,完全に核形成-成長型 相分離の相分離となる.通常,スピノーダル分解と核形成-成長型相分解は、異なる相分離メカニズムとして説明される 場合が多いが,原子の拡散の観点からは,基本的には1つ の非線形拡散方程式から計算される単一の現象である(5).た だし,図3の中央組成の濃度プロファイルと端の組成の濃 度プロファイルの比較からわかるように、得られる組織形態 は、スピノーダル線付近を境に大きく変化する. このこと が、従来、スピノーダル分解と核形成-成長型相分解を分け

g.drawLine(insetx+igx1, insety+igy1, insetx+igx2, insety+igy2);

}

int i:

//\*\*\*「データの保存」\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

private void datsave()throws Exception{

//保存ファイル名を test.dat とする. PrintWriter outfile=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter (''test.dat'', true))); //濃度プロファイルの描画

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

//ファイルのオープン(追記)



 (因 2 A-40 at % B 合金の 1000 K 等価時効における 次元濃度プロファイルの時間変化.
 (a) t' = 10, (b) t' = 20, (c) t' = 50, (d) t' = 200, (e) t' = 1000, (f) t' = 3000.



て考えてきた所以であろう(もちろんスピノーダル点は、過

飽和固溶体からの微小濃度揺らぎに対して、相分離に対する

化学的駆動力が負から正に変わる点であり、相分離の本質的

図3 A-B 合金の1000 K 等温時効(ť = 3000)における 1次元濃度プロファイルの合金組成による変化. (a) A-50 at%B, (b) A-40 at%B, (c) A-30 at%B, (d) A-20 at%B, (e) A-15 at%B, (f) A-10 at%B.

さて次に,このプログラムを2次元に拡張してみよう. 説明は以下のようになる(プログラム名はPD2D\_

import java.awt.event.\*; import java.io.\*; public class PD2D 001 extends Frame{ static int ndm=ND-1;
static int width; //濃度の分割数-1 //Window 全体の幅 static int height; //Window 全体の高さ //描画領域の幅 //描画領域の高さ static int xwidth; static int yheight; //Windowの枠の幅(左右および下) static int insetx; static int insety; //Windowの枠の幅(上) static double PI = 3.141592; static double RR = 8.3145; //π //ガス定数 static double[][]ch = new double[ND][ND]; static Graphics g; static double timel; static double temp; //温度(K) static double c0; //合金組成(モル分率) public PD2D 001(){ xwidth = 400; yheight = 400; insetx = 4; insety = 30; //描画画面の横と縦の長さ(ピクセル単位) //描画画面の枠の長さ width = xwidth + insetx\*2; height = yheight + insetx + insety; setSize(width, height); // 描画画面の中の皮と // 描画 Window 全体の横の長さ // 描画 Window 全体の縦の長さ // 描画 Window のセット setBackground(Color.white); //描画 Window の描画部の色を白に設定 setVisible(true); addWindowListener(new WindowAdapter() //描画 Window を見えるようにする {public void windowClosing(WindowEvent e) {System.exit(0);} //Window を閉じる時の操作(Windowの右上×の設定) }); } public static void main(String[] args) throws Exception{//例外処理は行わない PD2D\_001 prog = new PD2D\_001(); //PD2D\_001のインスタンス prog を生成 int i, j; int ip, im, jp, jm; double delt; // 並叙 // 整数(i+1,i-1,j+1,j-1) //時間刻み(無次元) //計算領域の1辺の長さ double al; //計算時間(最大カウント数) //拡散ポテンシャル //組織内の濃度データ予備配列 double time1max; double[][]ck = new double[ND][ND]; double[][]ch2 = new double[ND][ND]; //名ポテンシャル //濃度(Pe:1,Cu:2) //原子間相互作用パラメ・ double mu\_chem, mu\_surf; double c1, c2; double L0; ータ //濃度勾配エネルギー係数 //易動度関数とその微分 //濃度場の揺らぎの大きさ double kappa c; double Mc; double c\_flu; double cddtt; //濃度の増分 double b1; //差分ブロックサイズ 
 doublebl;
 // 走分ブロックワイへ

 doublec2ip,c2im,c2jp,c2jm;//差分ブロックにおいてc2を中心に、その上下左右の濃度

 doublesumc,dc;
 // 濃度場の総和,平均組成からのずれ
 //---- 各種パラメータ設定-temp=1000.0; c0=0.4; delt=0.04; //[ĸ] //合金の平均組成(ここでは A-40 at%B 合金を設定している) //時間きざみ //計算の繰返し回数 time1 = 0.0; timelmax = 1.0e + 08; //繰返し回数の最大値 al = 60.0;//2次元計算領域の1辺の長さ(nm) al = al\*1.0e - 9; //(m)に変換 //差分1ブロックのサイズ b1 = a1/(double)nd;//原子間相互作用パラメータ(J/mol) //無次元化 L0 = 2.5e + 04;L0 = L0/RR/temp; kappa c = 5.0e - 15;//濃度勾配エネルギー係数,単位は[Jm<sup>2</sup>/mol] kappa\_c=5.0e-15; // 0KT& -... kappa\_c=kappa\_c/b1/b1/RR/temp; //濃度勾配エネルギー係数, (b1'2\*rr\*temp)で無次元化 Mc = c0\*(1.0-c0);//拡散の易動度 c\_flu=0.1; //---- 時間 0 における初期濃度場設定--prog.ini\_comp\_field(); //prog.datin(); // //ファイルから読み込む場合 //---- 濃度場の時間発展の計算-------while(timel<=timelmax){ //---- 濃度場の表示--//カウント数が200の倍数おきに濃度場描画 if((((int)(time1)%200)==0)){prog.update\_draw(g);} \_\_\_\_\_//描画時のチラツキを抑えるため //if((((int)(time1)%200)==0)){prog.repaint();} 001.java). 先の濃度プロファイルの計算プログラムと比較 しながら見ていただきたい.

// 濃度場の保存	
1±((((int)(time1)%500)==0)){prog.datsave();} //カウン	ト数が500の倍数おきに濃度場保存
<pre>//if(timel = = 3000.0) {prog.datsave();} // ;</pre>	カウント数が3000の時に濃度場保存
// 拡散ポテンシャルの計算 for(i=0; i<=ndm; i++){ for(j=0; j<=ndm; j++){	
ip = i + 1; im = i - 1; jp = j + 1; jm = j - 1; $if (i = -n^2 m) (in = 0; j + f(i = -n^2)) (in = n^2 m)$	// 田圳44+64 田夕/4-
$if (j = ndm) \{jp = 0\} \ if (j = 0) \{jm = ndm\} \\ if (j = ndm) \{jp = 0\} \ if (j = 0) \{jm = ndm\} \\ $	//周期的境界条件
c2=ch[i][j]; c1=1.0-c2; c2ip=ch[ip][j]; c2im=ch[im][j];	//位置(i,j)における cl と c2
c2jp=ch[i][jp]; c2jm=ch[i][jm]; //	/差分において c2 の前後左右の濃度
$\texttt{mu\_chem} = \texttt{L0}^*(\texttt{c1}-\texttt{c2}) + \texttt{Math.log}(\texttt{c2}) - \texttt{Math.log}$	g(cl); //化学ポテンシャル差
$\texttt{mu_surf} = -2.0*\texttt{kappa_c}*(\texttt{c2ip}+\texttt{c2im}+\texttt{c2jp}+c2jp$	//濃度勾配のポテンシャル
ck[i][j] = mu_chem + mu_surf;	//拡散ポテンシャル
}	
// 濃度場の時間変化(非線形拡散方程式の差分解陽解法) for(i=0; i<=ndm; i++){ for(i=0; i<=ndm; i++){	
ip = i + 1; im = i - 1; jp = j + 1; jm = j - 1;	
$ \begin{array}{l} \mbox{if} (i = ndm) \{ ip = 0; \} & \mbox{if} (i = 0) \{ im = ndm; \} \\ \mbox{if} (j = ndm) \{ jp = 0; \} & \mbox{if} (j = 0) \{ jm = ndm; \} \end{array} $	//周期的境界条件 //周期的境界条件
$cddtt = Mc^{*}(ck[ip][j] + ck[im][j] + ck[i][jp] +$	ck[i][jm]-4.0* ck[i][j]); //非線形拡散方程式
$//ch2[i][j] = ch[i][j] + cddtt^delt;$ $ch2[i][j] = ch[i][j] + (cddtt + c flu^{(2.0*Math)})$	//濃度場の時間発展 h.random()-1.0)) *delt;
//	濃度場の時間発展(濃度揺らぎ導入)
}	
//***[濃度場の収支の補正] * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * *
//*** 数値計算であるので濃度場の収支の補止を行う(実際には sumc=0.;	毎ステップ行う必要はない).」**
<pre>for(i=0; i &lt; = ndm; i + +) {   for(j=0; j &lt; = ndm; j + +) {</pre>	
<pre>sumc = sumc + ch2[i][j]; }</pre>	//濃度場の積分
} dc=sumc/(double)nd/(double)nd-c0;	//濃庶堪の変動量
for(i = 0, i < -ndm, i + 1)	// (表)文句》 / (表)文句》 重
$for (j = 0; j < = ndm; j + +) \{$	//油 座相 の 妹丁
<pre>ch[1][]=ch2[1][]-cci if(ch[i][]&gt;=1.){ch[i][j]=1.0-1.0e-6;}</pre>	//濃度場の補止 //濃度が1を超えた場合の補正
if(ch_i]_j]<=0.){ch_i]_j=1.0e-6;} }	//濃度が 0 を切った場合の補止
}	
//***[時間增加] * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
)// WHILE	
//	
System.out.printf ('`¥n 終了しました. グラフの右上×をクリ	ックして終了してください. ¥n");
}//main	
//以下はサブルーチンである.	
//***初期濃度場設定 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * *
<pre>int i, j; double rnd0, fac1;</pre>	
fac1-0.01t //źл甘铅連	産择らぎの最十変化量を1℃に設定
for (i = 0; i < = ndm; i + +) {	反面りさり取べ及比重さ 2/0に設定
rnd0 = 2.0*Math.random() - 1.0;	
ch_i_j_j=c0+rnd0*fac1; }	//乱数にて初期濃度場を設定
}	
}	
//*** * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
//*** 濃度場描画  * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * *
<pre>public void paint(Graphics g) {     //g.clearRect(0, 0, width, height);</pre>	//Window をクリア
inti, j, ii, jj;	
<pre>int ixmin=0, iymin=0, igx, igy, irad0;</pre>	
<pre>int ixmax = xwidth, iymax = yheight; int icol;</pre>	
xmin = 0.; xmax = 1.;	//横軸の最小値,最大値
<pre>ymin = 0.; ymax = 1.;</pre>	//縦軸の最小値,最大値
rad0 = 1.0/(double)nd/2.0;	//差分ブロックの長さの半分 nax - xmin)*rad0);

//rad0 のピクセル化





このプログラムを実行すると、2次元濃度場の時間発展が リアルタイムにてパソコン画面で見ることが出来る.図4に 計算結果の濃度場の時間発展を示す.図4(a)~(h)は、合金 組成 $c_0 = 0.4$ (A-40 at%B)の時効温度1000 K におけるスピ ノーダル分解の時間発展である.図中の相分解組織の明暗が 局所的なB成分の組成に対応し、白~黒が0 at%B~100 at%Bを表している.また計算領域1辺は60 nm に設定し てある.

初期状態は過飽和固溶体(最大で±1%程度の濃度揺らぎ を乱数によって与えてある)であり,相分解の初期に均一な "まだら構造"が形成され[(a)-(d)],その後,組織は孤立 した微細な析出粒子が分散する組織となり[(e)-(g)],時効 の進行に伴いオストワルド成長によって析出相が粗大化して いく[(g)-(h)]. 合金組成や,時効温度を変えて種々の条件 下での相分解過程を,パソコン上にてその場観察しながら計 算を進めることができる.

さて以上は,相分離過程を計算するプログラムであるが, 実際に各種作業を進めるためには,保存された計算データを

A-40at%B at 1000K



図 4 A-40 at%B 合金の1000 K 等温時効における 2 次元相分離シミュレーション. (a) t'=0, (b) t'=10, (c) t'=20, (d) t'=50, (e) t'=100, (f) t'=200, (g) t'=300, (h) t'=500.

読み出して,濃度プロファイルや濃度場を表示するプログラム,個々の時間の濃度プロファイルデータを個別のファイル に取り出すプログラム(図2や図3のような図を書く時に必要),また濃度場の2次元数値データをjpg形式などのイメ ージファイルに変換して保存するプログラムなども必要である.これらのプログラムに関しては,紙面の関係で本講座で は説明しないが,これら作業用のプログラムも,本掲載プロ グラムのダウンロードページ(http://www.nims.go.jp/ mpsg/Phase-Field\_Modeling.htm)に公開するので,活用し ていただけると嬉しい(ただし公開しているプログラム等に 関して不具合・トラブルがあっても,著者および社団法人日 本金属学会は責任を負いませんのでご了承ください).

#### 2.4 おわりに

以上, A-B2 元系の拡散相分離シミュレーションを例にと り、パソコン上で簡潔に相分解シミュレーションを行うプロ グラムについて説明した.本プログラムは,学部や大学院に おける材料組織学の授業においても効果的に活用できると思 う. 最近では、多くの授業で PowerPoint による説明が行わ れるので、その場で、濃度プロファイルや濃度場の時間発展 をデモンストレーションすることは教育効果としても有効で あろう. もちろん, 本プログラムを少し改良するだけで, 現 実の2成分系相分離のプログラムを作成することができ る. 例えば, Fe-Crや Fe-Cuのフェライト相のスピノーダ ル分解プログラム(9)は比較的容易に作成可能である(ただし Gibbs エネルギー内の磁気項の取り扱いは若干複雑であ る). また本計算手法は連続体モデルに基づく解析であるの で、合金に限らず、セラミクスやポリマーアロイの相分離の 計算にも適用できる利点がある.特に近年,種々の分野で活 発に研究が進められているナノ・メゾスケールにおける材料 設計では、デバイスのスケール自体が微視的な材料組織のス ケールに重なってくるので、組織形態の解析が、これまでに

も増して重要となりつつある.この時,本稿のようなプログ ラミングのスキルを身につけておくことは,次世代の新材 料・デバイス設計において,有力な武器になるのではないだ ろうか.

なお本稿では、より基礎的な事項やさらに進んだ計算理論 の詳細については紙面の関係上ふれなかった.計算理論に関 する基礎に関しては文献(1)-(3)等をご参照願いたい.また 各種のデモプログラムやより進んだ計算理論の詳細について は、著者のホームページ(http://www.nims.go.jp/mpsg/ Phase-Field\_Modeling.htm)にて公開しているので、興味の ある方は参照していただきたい.次回は、マルテンサイト変 態の2次元シミュレーションプログラムについて解説する 予定である.

### 文 献

- (1) 小山敏幸: ふぇらむ, 9(2004), 240, 301, 376, 497, 905.
- (2) 小山敏幸:まてりあ, 42(2003), 397, 470.
- (3) T. Koyama: Chapter 21 in Springer Handbook of Materials Measurement Methods, H. Czichos, T. Saito and L. Smith (Eds), Springer-Verlag, (2006), 1031–1054.
- (4) T. Koyama: Science and Technology of Advanced Materials, **9**(2008), 013006.
- (5) T. Miyazaki, A. Takeuchi, T. Koyama and T. Kozakai: Trans. JIM, **32**(1991), 915–920.

- (6) J. E. Hilliard: Phase Transformation, ed. by H. I. Aaronson, ASM, Metals Park, Ohio, (1970), 497.
- (7) N. Saunders and A. P. Miodownik: CALPHAD, Pergamon, (1998).
- (8) J. W. Cahn: The Selected Works of J. W. Cahn, ed. by W. C. Carter and W. C. Johnaon, TMS, (1998), 29.
- (9)小山敏幸:ふぇらむ, 11(2006), 647.



*****	***********
1988年3月	名古屋工業大学大学院 工学研究科 博
1990年4月	工前期課程修了 名古屋工業大学大学院 工学研究科 博
1990年4月	工 该 期 課 任 単 位 取 侍 夜 返 子 名 古 屋 工 業 大 学 工 学 部 材 料 工 学 科 助 手
2002年4月	助子 (動物質・材料研究機構 計算材料科学研
2005年4月	第七ンター 主任研究員 ()物質・材料研究機構 計算材料科学研
2006年4月	第センター 王幹研究員 (納物質・材料研究機構 計算科学センタ
2009年4月	<ul> <li>一 王幹研究員</li> <li>一 一 王幹研究員</li> <li>一 一 一 王幹研究長</li> <li>一 一 一 王幹研究長</li> <li>一 一 王幹研究長</li> <li>- 一 王幹研究長</li> <li>- 一 王幹研究員</li> <li>- 一 王幹研究員</li> <li></li></ul>
現在に至る. 博士(丁学)	ンター 王幹研究員

専門分野:材料工学

主に材料組織形成の計算機シミュレーション研究に従事.

\*\*\*\*\*